

第 35 回分析電子顕微鏡討論会のお知らせ

主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会 分析電子顕微鏡分科会

協賛：日本物理学会、応用物理学会、日本表面科学会、日本金属学会、日本鉄鋼協会、日本分析化学会、
日本セラミックス協会、日本材料学会、触媒学会、軽金属学会、日本熱処理技術協会（依頼中含む）

日 程：2019 年 9 月 3 日（火）、4 日（水）（分析展 JASIS2019(主催：日本分析機器工業会) と共催)

会 場：幕張メッセ 国際会議室（千葉市美浜区中瀬 2-1）

参加費（予稿集含む）：顕微鏡学会員及び協賛学会員（個人会員）6,000 円、非会員 7,000 円、
学生 無料（予稿集別途 1,500 円）

内 容：分析電子顕微鏡に関わるチュートリアルと研究トピックス（一般講演含む）について講演が行われます。
チュートリアルでは、分析電頭の基軸となる EDS、EELS の基礎について詳しい講演がなされます。初日
のトピックスセッションでは、「新しい検出器と検出法による解析」に焦点をあてて最新の研究事例を紹
介します。二日目は「特殊分光法の基礎と応用」というトピックスセッションで角度分解 EELS や CL、
ビームロッキングを利用した EDS/EELS 分析に関する講演がなされます。また、さらに「ダメージを受
けない試料作製法」では無機材料から生物試料まで試料作製に関する詳しい講演がなされます。さらに、
二日目の午後には一般講演セッションに設定し、分析電頭に関わる活発な討論の機会を設けます。

詳細は <http://labs.eng.hokudai.ac.jp/lab/LIFM/bunseki/> をご覧下さい。

申込方法：参加申し込みは氏名、勤務先、所属、住所、電話番号、Fax 番号、e-mail アドレス、申込資格（会員・
協賛学会員・学生・非会員）をご記入の上、e-mail にて下記連絡先へお申し込み下さい。

一般講演を申し込まれる場合は、題目、発表者（共同研究者も含む）を併せて御連絡下さい。（一般講
演は、講演時間 12 分、討論 3 分）

参加費は当日会場受付でお支払いください。受付をスムーズに行うため、当日は釣り銭のないよう参
加費をご準備いただくようご協力お願い申し上げます。

連絡先：〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目

北海道大学大学院工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター

マルチスケール機能集積研究室 内

分析電子顕微鏡討論会事務局 坂口 紀史

Tel&Fax: 011-706-6768 E-mail: bunseki@eng.hokudai.ac.jp

締 切：一般講演申込締切 6 月 14 日(金)、同予稿締切 6 月 28 日(金)、事前参加登録締切 8 月 30 日(金)*

*当日の参加申し込みも歓迎いたしますが、できるだけ事前登録にご協力下さい。

第 35 回分析電子顕微鏡討論会 プログラム

(2019 年 4 月 17 日現在)

最新のプログラムは <http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/LIFM/bunseki/> よりご確認ください。

9 月 3 日(火) 10:00-16:30

1. チュートリアル

10:00-	EDS の基礎	金子賢治 (九州大学)
10:30-	TEM-EDS における定量分析の原理とその実際	森田正樹 (日本電子)
11:00-	EELS を用いた誘電特性解析の基礎	佐藤庸平 (東北大学)
11:30-	内殻励起スペクトルの基礎と応用	治田充貴 (京都大学)

— 昼休み —

2. トピックス 1 「新しい検出器と検出法による解析」

13:30-	DPC による電磁場定量法の基礎	関岳人 (東京大学)
14:00-	タイコグラフィーによる電子線の位相回復の初歩	三石和貴 (NIMS)
14:30-	微分位相コントラスト STEM のソフトマテリアルへの適用	稲元伸 (東レリサーチセンター)
— 休憩 —		
15:10-	ピクセル型高速 STEM 検出器を用いた STEM-CBED 法による局所構造解析	津田健治 (東北大学)
15:40-	TEM による結晶方位マップおよび相マップの作製	鈴木清一 (TSL ソリューションズ)
16:10-	総合討論	

9 月 4 日(水) 10:00-16:55

1. トピックス 2 「特殊分光法の基礎と応用」

10:00-	角度分解 EELS による表面プラズモンの分散測定	齋藤光 (九州大学)
10:30-	ビームロッキング EDS/EELS 分析：電子チャネリング効果を活用したサイト選択的定量組成・電子状態評価	大塚真弘 (名古屋大学)
11:00-	角度分解カソードルミネセンス STEM による表面プラズモンモードの抽出と干渉	三宮工 (東京工業大学)

— 昼休み(分析展 JASIS2019 の見学を含む) —

2. トピックス 3 「ダメージを受けない試料作製法」

14:00-	取り扱い時にダメージを受けやすいソフトマテリアルの電顕試料作製方法と観察方法	広瀬治子 (帝人)
14:30-	機能性デバイスのオペランド観察に必要な電圧印加用 TEM 試料作製技術	山本和生 (JFCC)
15:00-	金属および酸化物の SEM 観察試料作製 ～実例をもとに～	赤嶺大志 (九州大学)

3. 一般講演 (各 15 分)

15:40-